

华光 RP-7 型电路板光绘胶片使用说明书

高品质的电路板制作从华光 RP-7 开始。。。。。

★用 途：

RP-7 型电路板光绘胶片是我厂自主研发的、适合于激光波长为 630~670nm 的氦氛激光和红激光二极管曝光光源的光绘机，专为电路板制作设计的光绘胶片。本产品具有良好的尺寸稳定性、感光度适中、显影适应性强、线条再现性好、适合高温快速加工等特点。

主要性能特点：

应用尺寸稳定性良好的、厚度为 7mil (0.175mm) 的聚酯片基；
药膜面不带磨砂，可消除磨砂颗粒在乳剂层中引起的针孔等缺陷；
高反差、高分辨率、底灰小、高密度；
线条再现性好、清晰度高；
优良的防静电和防灰尘技术；
适应各种套药的高温快速加工，最快显影时间可达 25 秒左右；
暗室上片。

★规 格（英寸）：

24×28×50 张	24×30×50 张	24×26×50 张	16×20×50 张
12×18×50 张	16×20×50 张	26×26×50 张	20×26×50 张
22×26×50 张	22×28×50 张	20×24×50 张	24×30×50 张

另可根据用户要求裁切任何可需求的规格。

★包 装：

散叶片盒装。

★启封与安全灯：

本胶片应在全黑或暗绿灯条件下启封和应用，暗绿色安全灯距离胶片应不少于 1.5 米，同时避免直射。使用时应小心因摩擦、折叠、油渍、指纹等因素造成胶片的损害。

★曝 光：

曝光量是由光绘机特性和显影加工条件共同决定的，最佳的曝光量必须根据不同型号的光绘机通过不同的曝光试验来测试，从而获得最佳的曝光量，同时由于显影时间和温度对图像的品质也有很大的影响，因此，在调整光绘机曝光量时，也要对显影温度和时间进行适当的微调，以确保在特定曝光量条件下获得高品质的图像。**RP-7 光绘胶片在弱曝光量、较强显影条件下更容易获得高质量的图像品质。**

胶片在曝光之后应尽快冲洗。

★冲洗加工：

本产品推荐使用华光 HG-2000 和 HG-963 型套药，也可使用爱比西、太行、科艺等其它品牌的显影套药。

推荐显影加工条件（可根据最大密度要求适当调整显影时间）：

显影温度	显影时间	备 注
30℃	40~55 秒	
32℃	30~45 秒	
35℃	20~30 秒	

胶片的干燥温度以 40~50℃最佳，超过 50℃时会增加底灰密度、胶片尺寸变化等弊病。

备注：水洗时尽量使用循环水，以免水洗不彻底使胶片长时间放置时变黄。

★储 存：

干冷保存，储存温度应低于 20℃，相对湿度小于 65%。

湿热保存将会缩短胶片的保质期和使用寿命、胶片的收缩率增加等。

避免受放射性或其它有害物质的侵蚀。

★保质期：

十八个月

★执行标准：

HG/T2172-2003